

Join the 9th edition of Metrommeet on 7th + 8th March 2013
Ven a la 9ª edición de Metrommeet el 7 y 8 de Marzo de 2013

Fax Registration

Inscripción por fax · Fax: +34 94 480 51 84

Binding registration (please mark) / Inscripción (por favor indique la opción deseada)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Conferences / Conferencias | ☐ Banquet / Cena | 800 Euros (944 incl 18% Vat / IVA)
(Banquet included / Banquete incluido) |
| ☐ Tutorials only / Sólo tutoriales | | 350 Euros (413 incl 18% VAT / IVA) |
| ☐ Day ticket / Entrada de un día | | 500 Euros (590 incl 18% VAT / IVA) |

Name & Surname / Nombre y Apellidos

Contact Name / Persona de Contacto

Company / Empresa

VAT / CIF

Job Title / Cargo

Street (P.O. Box) / Calle (Apartado Postal)

Postal Code-City / Código Postal-Población

Country / País

Phone-Fax / Teléfono-Fax

E-mail

☐ Yes, I would like to receive the Metrommeet Newsletter
Sí, me gustaría recibir el newsletter de Metrommeet

Sponsor



Organiser



In collaboration with



Contact Information

Telephone: (+34) 94 480 51 83
info@metrommeet.org

Exhibitors



Supporting Organisations



Media Partners



Metrommeet 2012

Conference
Edition

8th International conference on
Industrial Dimensional Metrology



www.
metrommeet.org

8+9 March
2012

Bilbao
Spain

Tutoriales



Antonio Ventura-Traveset Datapixel [Spain]

The digital metrology workflow, a new paradigm for the knowledge based manufacturing

Antonio Ventura-Traveset es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, especialidad en Electrónica. Es fundador y Director General de DATAPIXEL en España. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la European Machine Vision Association (EMVA). Miembro de varios comités internacionales de estándares, incluyendo el comité OSIS (Optical Sensor Interface Standard) de la ia.cmm.

Antonio Ventura-Traveset graduated as a telecommunications Engineer (option: Electronics) at the Polytechnic University of Catalonia (UPC), Spain. Mr Ventura-Traveset is founder and General Manager of DATAPIXEL in Spain. He is a member of the Executive Committee of the European Machine Vision Association (EMVA) and of some international committees working on standards, one of them is the OSIS committee (Optical Sensor Interface Standard) of the ia.cmm.

Keynotes

Thomas A. Campbell, Ph.D. Institute for Critical Technology and Applied Science, Virginia Tech [USA]

Metrology for Additive Manufacturing Opportunities in a Rapidly Emerging Technology



Thomas A. Campbell es Profesor Asociado de Investigación y Director Asociado de Extensión el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología Crítica (ICTAS) en Virginita Tech. Su especialización son los nanocomposites (síntesis, caracterización y aplicaciones). Tom llegó a Virginia Tech procedente de ADA Technologies, donde ejercía como Científico Investigador Sénior y Director del Programa de Nanotecnología.

Thomas A. Campbell is Research Associate Professor and Associate Director for Outreach with the Institute for Critical Technology and Applied Science (ICTAS) at Virginia Tech. His research specialization is nanocomposites (synthesis, characterization, and applications). Tom joined Virginia Tech from ADA Technologies, Inc., where he was Senior Research Scientist and Nanotechnology Program Manager.



Gabriele Jansen Vision Ventures GMBH & CO. KG [Germany]

3D Machine Vision – An Overview

Gabriele Jansen es CEO and propietaria de Vision Ventures. Con una gran experiencia de 20 años en la industria de la visión artificial, la mayoría como empresaria, ofrece una mezcla única de conocimiento de la industria, conocimiento tecnológico y visión empresarial. Además de sus actividades como empresaria, Gabriele Jansen es miembro del Comité Ejecutivo de la EMVA y trabaja habitualmente como consultora para la Comisión Europea.

Gabriele Jansen is the CEO and owner of Vision Ventures. With a good 20 years of experience in the machine vision industry, mostly as an entrepreneur in her own right, she offers a unique mixture of industry knowledge, technological insight and business acumen. In addition to her entrepreneurial activities, Ms Jansen is a member of the Executive Committee of the European Machine Vision Association EMVA and works regularly as a consultant for the European Commission.

Registration Process

Please register by Fax, Mail or internet. As soon as we receive your registration, we will send you a confirmation. We will send you a confirmation, as soon as we receive your registration.

Payment

Payment shall be made by means of a bank transfer, addressed to Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia at La Caixa, to account No. ES58/2100/0732/26/0200711986 indicating your name and company. Please send proof the voucher of payment by fax or e-mail.

Fees

- Conferences and Tutorials: 800€
- Only Tutorials: 350€
- Day Ticket: 500€

Fees are subject to 18% VAT for all delegates.

Observations

(*)"In agreement with Article 5 and concordant with the current Organic Law 15/1999, 13 of December, Protection of Personal Data (BOE, Character data num. 298, of 14-12-1999), the Innovalia Association, S.A., informs you that an automated file exists with data of a personal character, the purpose of which is to inform you about the activities of a divulgent, educational or scientific nature carried out by the company that may interest you. The organisation in charge of this file is Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia., with address in C/Rodríguez Arias, nº6 6º 48008 Bilbao (Vizcaya), VAT G-95210910, telephone +34 94 480 51 83 and fax +34 94 480 51 84. In agreement with the law before mentioned, you can any time exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition notifying it writing to the direction before expressed or the electronic mail".

Discounts

The sooner you register, the greater the benefit you will enjoy. We have a special discount for the ones who decide early:

- 20% discount on any registration made before the 31st of December 2012
- 15% discount on any registration made before the 10th of February 2013

If you belong to a 'special' group as listed below, you can have discount as well, and of course those discounts count all the time.

- 50% discount for students
- 20% discount for sponsors
- 15% discount for supporting exhibitors
- 10% discount for organisations

These discounts are not cumulative. If you apply more than one discount, only the biggest one will be taken into account.

Cancellations

All cancelations must be sent on a written format before the 1st of March 2013 and they will be subject to a 10% charge. There will be no refunds after the stated date.

Proceso de inscripcion

Puede registrarse por Fax, Mail o Internet. Una vez recibamos la inscripción, le enviaremos la confirmación de la misma.

Forma de pago

Mediante transferencia bancaria a nombre de Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, en el número de cuenta de La Caixa 2100/0732/26/0200711986, indicando nombre y empresa. Por favor, envíenos por fax o por e-mail el justificante de pago.

Precio

- Tutoriales y Conferencias: 800€
- Sólo tutoriales: 350€
- Entrada de un día: 500€

Estos precios no incluyen el 18% de IVA.

Observaciones

(*) "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y concordantes de la vigente ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14-12-1999), la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia le informa de que existe un fichero automatizado de carácter personal que tiene como finalidad informar sobre las actividades de carácter divulgativo, docente o científico de esta empresa que pudieran interesarle. El responsable de dicho fichero es la dirección de la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, con domicilio en C/Rodríguez Arias, nº6 6º 48008 Bilbao (Vizcaya), CIF G-95210910, teléfono +34 94 480 51 83 y fax +34 94 480 51 84. De acuerdo con la ley antes citada, puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, notificándolo por escrito a la dirección antes expresada o al correo electrónico".

Descuentos

Cuanto antes gestiones tu inscripción, disfrutarás de más beneficios. La organización de Metromeet tiene un descuento especial para los que antes se decidan:

- 20% de descuento para inscripciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2012
- 15% de descuento para inscripciones realizadas antes del 10 de febrero de 2013

Si pertenece a algún grupo de los mencionados a continuación, puede obtener un descuento también a lo largo de todo el evento.

- 50% de descuento para estudiantes
- 20% de descuento para sponsors
- 15% de descuento para expositores
- 10% de descuento para empresas colaboradoras

Los descuentos no son acumulables. En caso de que corresponda la aplicación de más de un descuento, se aplicará el mayor.

Cancelaciones

Deberán ser recibidas por escrito antes del 1 de marzo de 2013 y estarán sujetas a un 10% de penalización. No se harán devoluciones a cancelaciones recibidas después de esa fecha.

March 8 Marzo

A3 - 1 Room

A3 - 2 Room

08:30 - 09:00	Registration + Coffee	
09:00 - 11:15	Tutorial 1	Tutorial 2
	The digital metrology workflow, a new paradigm for the knowledge based manufacturing Antonio Ventura-Traveset - Datapixel (Spain)	Nano-metrology; Accuracy of interferometric measurements Han Haitjema- Mitutoyo (The Netherlands)
		
11:15 - 12:00	Coffee Break + MetroLab	
12:00 - 12:30	Opening	
12:30 - 13:30	Keynote	
	Metrology for Additive Manufacturing Opportunities in a Rapidly Emerging Technology Thomas Campbell, Ph.D. - Institute for Critical Technology and Applied Science (ICTAS), Virginia Tech (USA)	
13:30 - 15:00	Lunch	
15:00 - 17:15	Track 1 + Metrology solutions	Track 2 + Optical Metrology
15:00 - 15:45	Intelligent Camshaft Manufacturing Systems. Dimensional Quality Control in the Factory Line Iñigo Pérez - Engine Power Components (EPC) (Spain)	Advanced point cloud information management for inline quality control Dr. Oscar Lázaro - Innovalia Asociation (Spain)
15:45 - 16:30	A new Concept for High-Speed atline and inlineCT for up to 100% Mass Production Process Control Jens Lübbenhüsen - GE Sensing & Inspection Technologies (Spain/Germany)	Metrological solutions for diffractive optics manufacturing Pere Pont - Datapixel (Spain)
16:30 - 17:15	3D and metrology in an unusual and very challenging environment: the In Vessel Viewing System (IVVS) of ITER Ignazio Piacentini - Imaging Lab (Italy)	Pending Confirmation
17:15 - 18:15	Keynote	
	How accurate are Computed Tomography dimensional measurements? Simone Carmignato - Università de Padova (Italy)	
20:30 - 23:00	Conference Banquet	

March 9 Marzo

A3 - 1 Room

A3 - 2 Room

09:00 - 09:30	Registration	
09:30 - 10:30	Keynote	
	3D Machine Vision – An Overview Gabriele Jansen - Vision Ventures GMBH & CO. KG (Germany)	
10:30 - 11:15	Coffee Break	
11:15 - 13:30	Track 3 + Industrial Metrology	Track 4 + Nano & Micrometrology
11:15 - 12:00	Metrology in Micro System Technologies Dr. Reiner Götzen - Micro electronics (Germany)	Magneto-Optical Measurement techniques for Magnetic Materials Metrology Dr. Andreas Berger - CIC nanoGUNE (Spain)
12:00 - 12:45	Minimising the cost of measurement in manufacturing Nick Orchard - Rolls-Royce plc (UK)	3D capability for nanopositioning and nanometrology Denis Dontsov - SIOS (Germany)
12:45 - 13:30	Industrial metrology in automotion Javier Díaz - Seat (Spain)	A two-dimensional moving platform with nanometer resolution to increase the measuring range of AFMs José A. Yagüe-Fabra PhD. - Universidad de Zaragoza (Spain)
13:30 - 15:00	Lunch	
15:00 - 16:30	Track 5 + Calibration & Verification	Track 6 + Metrological Software
15:00 - 15:45	Large Machine tool 5 DOF Verification Aitor Olarra - IK4 – Tekniker (Spain)	The future of Metrological Software Eva Alonso & Julen Maneros - CBT (Spain)
15:45 - 16:30	Measurement uncertainty associated with coordinate measurements: evaluation and reduction Maryna Galovska - IPROM (Germany)	Using measurement and software to optimise part setup for machining Philip Hewitt - DELCAM PLC (UK)
16:30 - 17:30	Keynote	
	Nanotechnology Roadmap Michael Meador Ph.D - NASA (USA)	
17:30 - 18:00	Round Table + Closing	
18:00 - 18:30	Closing Cocktail	

* Simultaneous translation of all presentations will be made available to all attendees.
Todas las presentaciones tendrán traducción simultánea.

* The organization reserves the right to reschedule, add or cancel presentations.
La organización se reserva el derecho a modificar horarios, añadir o cancelar presentaciones.

Metromeet



Metromeet is a unique conference, on Industrial Dimensional Metrology, hold in Bilbao since 2005. Metromeet is consolidated as a reference in an industry that changes rapidly. This unique event attracts world leaders in the field of Industrial Dimensional Metrology will bring you the latest news about digital & optical developments, metrological software, nano-technology and calibration standards. The most representative companies and organisms of the sector present annually in Metromeet, the state-of-the-art developments in Metrology.

Innovalia Association, an independent private Associated Research Lab, which was created by Group Innovalia for articulating a critical research mass capable of effectively addressing the Group ambitious and long-term strategic research objectives, organizes Metromeet since the beginning.

Bilbao

Metromeet yearly takes place in the beautiful city Bilbao. Bilbao is a city with a wide **cultural and gastronomic** offer: The **Guggenheim** Museum, a 20th century architecture masterpiece, was opened in 1997 and has turned Bilbao into an international artistic centre and the Fine Arts Museum de Bilbao (Museum of Fine Arts) which owns the second best classical art collection in Spain. Bilbao is home to the **best Basque restaurants** and chefs. Its restaurants range between the awarded restaurants and the cider houses, taverns, outdoor bars. You will surely find a quality restaurant that fits your taste and Budget.

Metromeet es una conferencia única, dedicada a la Mtrología Industrial Dimensional, que se celebra en Bilbao desde 2005. Metromeet es referente internacional; un evento único que atrae a los líderes mundiales en el sector de la Metrología Industrial Dimensional, donde se presentan los últimos desarrollos digitales y ópticos, software metrológico, nanotecnología y estándares de calibración. Las entidades más representativas del sector presentan anualmente en Metromeet, los avances más punteros del panorama metrológico actual.

La Asociación Innovalia, Laboratorio de Investigación privado, que fue creado por el grupo Innovalia para articular una masa crítica capaz de acometer con éxito sus ambiciones y objetivos estratégicos de investigación a largo plazo, organiza Metromeet desde su primera edición.

Bilbao

Metromeet se lleva a cabo anualmente en Bilbao, una ciudad con una amplia **oferta cultural y gastronómica**. El Museo **Guggenheim**, obra maestra de la arquitectura del siglo XX, ha convertido a Bilbao en un centro artístico internacional y el Museo de Bellas Artes de Bilbao posee la segunda mejor colección de arte clásico en España. Bilbao posee varios de los mejores restaurantes de la geografía estatal y **grandes restauradores de renombre**. Su oferta gastronómica ofrece desde restaurantes premiados o las famosas sidrerías, hasta las tabernas o bares al aire libre. Usted podrá encontrar un restaurante de calidad que se adapte a su gusto y presupuesto.

Tutorials

Han Haitjema
Mitutoyo [The Netherlands]

Nano-metrology; Accuracy of interferometric measurements



Han Haitjema se licenció en Físicas por la Universidad de Utrecht en 1985. Cuatro años más tarde, obtuvo su Doctorado en la Universidad Tecnológica de Delf. En 2004, se unió a Mitutoyo como director del Centro Europeo de Investigación, en Best (Holanda). Su investigación abarca todos los aspectos de la metrología dimensional. Durante casi dos décadas de trabajo, ha publicado numerosos artículos técnicos en periódicos internacionales y ha participado de forma habitual en conferencias.

Han Haitjema obtained his MSc in Physics at the Utrecht University in 1985. He obtained his PhD at the Delft University of Technology in 1989. In 2004 he joined Mitutoyo as the director of Mitutoyo Research Center Europe in Best, The Netherlands. His research interests cover all aspects of dimensional metrology. During almost two decades of research work, he has published many technical papers in domestic and international journals and regularly presented his work in international conferences.



Simone Carmignato
Università de Padova [Italy]

How accurate are Computed Tomography dimensional measurements?

El Dr. Simone Carmignato imparte Ingeniería de Fabricación en la Universidad de Padua (Italia) y es uno de los principales investigadores científicos en el grupo de investigación dedicado a la Ingeniería de Precisión de Fabricación. Su actual investigación se centra en el área de la Metrología Industrial Geométrica, incluyendo metrología por coordenadas multisensor y tomografía computerizada. El Dr. Carmignato ha coordinado múltiples proyectos internacionales de investigación, incluyendo comparaciones entre laboratorios acerca de metrología óptica por coordenadas y tomografía computerizada.

Dr. Simone Carmignato teaches Manufacturing Engineering at the University of Padova, Italy, and is a Principal Research Scientist in the Precision Manufacturing Engineering research group. His current research activities are in the area of Industrial Geometrical Metrology, including multisensor coordinate metrology and computed tomography. Dr. Carmignato has coordinated several international research projects, including interlaboratory comparisons on optical coordinate metrology and computed tomography.

Michael Meador Ph.D
NASA [USA]

Nanotechnology Roadmap



Michael Meador es responsable de la gestión técnica de un gran número de proyectos de la NASA para el desarrollo de nanotecnologías de alto potencial de impacto en las misiones de la NASA. El proyecto conlleva trabajo de 5 centros de la NASA, empresas y universidades. Es el representante de la NASA en el Subcomité de Tecnología, Ingeniería y Ciencia en Nanoescala, el grupo de orientación para organismos Federales que participan en la Iniciativa Nacional de Nanotecnología.

Michael Meador is responsible for technical management of a NASA -wide project to mature nanotechnologies with high potential for impact on NASA missions and demonstrate them in selected applications. The project involves work at 5 NASA centers, industry and universities. He is NASA's representative to the Nanoscale Science, Engineering and Technology Subcommittee, the steering group for Federal agencies participating in the National Nanotechnology Initiative.